

令和6年11月6日

会員各位

公益社団法人 応用物理学会
次世代リソグラフィ技術研究会
幹事長 宮本 恭幸

第3回定例会開催通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、次世代リソグラフィ技術研究会の第3回定例会のご案内が出来ましたので、お送りさせていただきます。今回もオンライン定例会になります。定例会の参加につきましては、事前登録の必要はございません。当日お時間になりましたら、下記へ直接アクセスしてください。追記に注意事項を記載いたしましたので、ご確認ください。

また、出来るだけ多くの方に参加していただきたいので法人会員の方は社内での回覧も併せてお願いいたします。 敬具

記

1. 開催日時：令和6年12月16日（月） 定例会：13:00 – 16:35

2. 開催場所：オンライン定例会（Zoomでのライブ配信）

以下にアクセスください。

<https://us06web.zoom.us/j/81653588985?pwd=luUT43K1Q9INxjclhkC06rxgRGMLbm.1>

※参加希望の方は、事務局にメールにてお問合せお願い致します。（会員のみ参加可能）

3. 参加費： 会員：無料

4. プログラム：「 SPIE Photomask Technology + EUV Lithography 2024 (PUV24) 特集 」

13:00～13:05	『 開会の挨拶 』	東京科学大学 宮本 恭幸氏
13:05～13:20	『 SPIE PUV 24 概要 』	産業技術総合研究所 井谷 俊郎氏
13:20～13:55	『 基調講演 』	ALITECS (株) 岡崎 信次氏
13:55～14:30	『 露光装置 』	AS Lithography Consulting 鈴木 章義氏
14:30～15:05	『 SPIE PUV 2024 マスク関連報告 』	大日本印刷 (株) 長井 隆治氏
15:05～15:25	～ 休憩 ～	
15:25～16:00	『 光源関連 』	九州大学 溝口 計氏
16:00～16:35	『 レジスト関連 』	大阪大学 古澤 孝弘氏

以上

- 追記：・録画や録音は禁止させていただきます。
- ・発表者以外はミュートをお願いいたします。
 - ・参加者を明らかにするため、ログイン名を所属+名前に変更ください。
#参加者リストで自分の名前にマウスを合わせ「詳細」をクリックすると
#名前を変更できます。

また、ご不明な点がございましたら下記担当者までお問い合わせ下さるようお願い致します。

事務局：公益社団法人 応用物理学会

次世代リソグラフィ技術研究会担当／相良（サガラ） 好美

TEL (携帯)：090-5403-1147

E-mail: ngl@jsap.or.jp